(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-134048

(43)公開日 平成8年(1996)5月28日

(51) Int.CL⁶

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示簡所

C 0 7 D 263/12 # C 0 7 M 7:00

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出職番号 特爾平6-273475

(22) HIMM E

平成6年(1994)11月8日

(71)出願人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72) 発明者 池 平 秀 行

大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化 学工学株式会社内

(72)発明者 柳 川 正 生

大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化 学工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 久保山 隆 (外1名)

(54) 【発明の名称】 オキサゾリン類の製造法

(57) 【要約】

【構成】一般式3 $R^1 - CN$

で示されるニトリル類と、一般式2



で示されるアミノアルコール類とを、ルイス酸およびモ レキュラーシーブの共存下に反応させることを特徴とす る一般式1



で示されるオキサゾリン類の製造法。

【効果】本発明の方法によれば、ニトリル類とアミノア

キサゾリン類は勿論、ラセミや光学活性なオキサゾリン 類を容易に製造することができる。

ルコール類とから一工程で、しかも原料化合物中に水分

が存在していても、予め脱水することなくそのまま反応

原料として使用することができ、不斉炭素を有さないオ

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式3

 $R^1 - CN$

(式中、R¹ は置換基を有していてもよいアルキル基も しくはアラルキル基もしくはアリール基を示す。) で示 されるニトリル類と、一般式2



(式中、R²、R³、R⁴ およびR⁵ は同一または相異 なって水源原子、置機基を有していてもよいアルキル基 もしくはアラルキル基もしくはアリール基を表す。)で 示されるアミノアルコール類とを、ルイス酸およびモレ キュラーシープの共存下に反応させることを特徴とする 一般式1

(式中、 ${\bf R}^1$ 、 ${\bf R}^2$ 、 ${\bf R}^3$ 、 ${\bf R}^4$ および ${\bf R}^5$ は前記と同じ意味を有する。)で示されるオキサゾリン類の製造 注

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、オキサゾリン類の製造 法に関する。

[0002]

【従来の技術】オキサソン、知は医薬、農薬、機能性料 特などの中間体として公知であり、その製造法として、 ニトリル頭とアミノアルコール製とを酢酸亜肉などの触 媒の存在下に、反応系内の水分含量を1.0重載%以下 に維持して反応させる方法(特間平5-140129号 公報)があしれている。

【0003】しかし、この方法による場合には、反応系 内の水分合量の維持のために、予め各反応原料や機能を 乾燥させで肥大しなければならず、工業的機能法として 有利な方法とは言えなかった。また、この方法において はラセミあるいは光学活性なオキサブリン類の製造に関 しては今く影響をれていなかった。

[0004]

 製造できる方法について検討の結果、本発明に至った。

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式3

 $R^1 - CN$

(式中、R¹ は置換基を有していてもよいアルキル基も しくはアラルキル基もしくはアリール基を示す。)で示 されるニトリル類と 一般式2

(式中、R²、R³、R⁴ およびR⁵ は同一または相異 なって水薬原子、脳機基を有していてもよいアルキル基 もしくはアラルキル基もしくはアリー本基を表す。)で 示されるアミノアルコール類とを、ルイス酸およびモレ キュラーシープの共存下に反応させることを特徴とする 一般式1

(式中、 ${\bf R}^1$ 、 ${\bf R}^2$ 、 ${\bf R}^3$ 、 ${\bf R}^4$ および ${\bf R}^5$ は前記と同じ意味を有する。)で示されるオキサゾリン類の製造法を提供するものである。

【0006】本発明における目的化合物および各反応原 料は、それぞれ上記一般式1、2および3で表される が、これら一般式において、アルキル基としてはメチル 基、エチル基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、tーブチル基、nーアミル 基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基、シクロヘキシル 基、 n-オクチル基、 n-ノニル基などが、アラルキル 基としてはベンジル基、2-フェニルエチル基、2-ナ フチルエチル基、ジフェニルメチル基などが、アリール 基としてはフェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、フ リル基。チオフェニル基などがそれぞれ例示され、これ らの基がさらに置換基で置換されている場合の置換基と しては、クロル、プロムなどのハロゲン原子、メチル 基、エチル基、イソプロビル基、n-ブチル基、t-ブ チル基、n-アミル基、n-ヘキシル基などの低級アル キル基、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、 tープトキシ基などの低級アルコキシル基、フェノキシ 基などのアリールオキシ基、nープロピルチオ基、t-プチルチオ基などの低級アルキルチオ基、フェニルチオ 基などのアリールチオ基、ニトロ基、水酸基などが例示

【0007】これら各反応原料の具体的化合物として、 一般式3で示されるニトリル類としては、たとえばアセ トニトリル、n-プロピオニトリル、n-ブチロニトリ ル. 2-クロローn-ブチロニトリル. シクロヘキサン カルボニトリル、ベンゾニトリル、αートルニトリル、 p-ニトロベンゾニトリルなどが、一般式2で示される アミノアルコール類としては、たとえば2-アミノエタ ノール、1-アミノー2-プロパノール、2-アミノー 3-メチル-1-ブタノール、フェニルグリシノール、 フェニルアラニノール、2-アミノー1,2-ジフェニ ルエタノール、イソロイシノール、バリノール、ノルエ フェドリン、2-アミノー(4-メトキシフェニル)-1ープロパノール、2ーアミノー(4ークロロフェニ ル) -1-プロパノール、3-フェノキシ-2-アミノ -1-プロパノールなどがそれぞれ挙げられ、これらア ミノアルコール類は前記一般式2における置換基R2 と R⁴、または/およびR³とR⁵が異なる場合に、該化 合物はラセミ体であってもよいし光学活性体であっても

【0008】この反応に使用されるルイス酸としては、 アルミニウムトリクロライド、ボロントリフルオライ ド、塩化圧動、塩化鉄、泉化鉄、塩化スズ、アルミニウ ムトリイソプロポキシド、酢酸亜鉛などが例示される。 かかるルイス酸の使用量は、原料であるアミノアルコー ル類に対して、通常0.01~10モル倍、好ましくは 0.1~3年ル倍の範囲である。

【0009】また、モレキュラーシーブとしては、ビー 水状やペレット状の3A、4A、5Aなどの通常脱水剂 として使用されているものが使用され、その使用量は反 応承中の水分量によっても異なるが、通常は原料である アミノアルコール類に対して0.01~100重量件、 好ましくは0.5~10重量件の範囲である。

【0010】この反応における原料ニトリル報とアミノ アルコール類との使用制合は、モル比として通常の.5 ~3:1好ましくは0.5~2:1であり、これら原料 化合物が水分を含んでいても何ら差し支えない。反応は 通常溶媒中で行われ、溶媒としてはトルエン、キシレ ン、ペキサン、オクタン、タロルペンゼンなどのルイス 酸を用いる反応に不活性な溶媒が使用されるが、原料ニ リル軍の係職によってはまこりル類自体を溶媒とし て、あるいはこれら溶媒と混合して使用することもで き、この場合にはニトリル類は前記した使用範囲を越え で溶媒 極便用される。

【0011】 反応温度は50~250℃、好ましくは6 0~150℃の範囲であり、反応時間は特に制限されず、原料のアミノアルコール類の消失したときを反応の終点とすることができる。

【0012】反応終了後、ろ過等によってモレキュラー シーブを除去し、たとえばる液に飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液などのアルカリ水溶液を加え、析出する固体を ろ過等によって除去したのちこれを濃縮し、これに水を 加えたのちトルエン、酢酸エチル、ジエチルエーテル、 ジクロルメタンなどの有機溶媒で抽出し、有機層を濃縮 することにより目的化合物を単維することができ、さら に必要あれば蒸留やカラムクロマトなどによってこれを 特製することもできる。

【0013】かくして、一般式1で示されるオキサゾリン類、たとえば2ーメチルー4ーフェニルオキサゾリン、5ーメチルー2ーフェニルー2ーオキサゾリン、2ーエチルー4ーフェニルー5ーメチルオキサゾリン、2ーズェルー4ーtーブチルー5ーエチルオキサゾリン、2ーズンシルー4ーtーブチルー5ーオキサゾリン、2ープロピルー4ーエチルー5、5ージメチルオキサゾリン、2ーメチルー4ーイソブロピルオキサゾリン。2ーメチルー4ーイソブロピルオキサゾリンなどが製造され、原料であるアミノアルコール質がラセミ体あるいは光学活性体である場合には、該原料に対応したラセミあいは光学活性なオキサゾリン類が得られる

[0014]

【発明の効果】 本発明の方法によれば、ニトリル類とア ミノアルコール類とから一工程で、しかも原料化合物中 に水分が存在していても、予め脱水することなべそのま ま反応原料として使用することができ、不者良美を有さ ないオキサブリン類は勿論、ラセミや光学活性なオキサ ブリン類は多場に製造することができる。

[0015]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に脱明するが、本発明がこれによって限定されるものでないことはいうまでもない。

【0016】実施例1

(R) - (-) -フェニルグリシノール10 (72.9 ミリモル)を4重量%の水を含むアセトニトリル300 g に溶解させ、これにビーズ状のモレキュラーシープ4 Aを80g加えたのち、30分間窒素気流下に攪拌す る。この溶液に塩化亜鉛10g (73.4ミリモル)を 加え、加熱環流しながら7時間機律する。反応終了後、 反応混合液をろ過してモレキュラーシーブを除去し、分 離したモレキュラーシープをアセトニトリル (50g× 2) で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、これに飽和炭酸 水素ナトリウム水溶液400gを加え、室温で30分間 機拌したのち、析出した固体をろ別する。ろ液をほぼア セトニトリルが除去されるまで濃縮したのち、濃縮液を 400gの水中にあけ、酢酸エチル (300g×2) で 抽出処理を行なう。得られた抽出有機層を100gの水 で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後滯縮し、滯縮液 をクロロホルムーアセトン (20:1) にてシリカゲル カラムクロマト精製し、4R-2-メチル-4-フェニ ルオキサゾリン 9、21 g (57、2ミリモル) を得 た。 収率 78.5%

【0017】実施例2

(S) - (+) -2-アミノ-3-メチル-1-ブタノ ール10 (96.9ミリモル)を4重量%の水を含むア セトニトリル300gに溶解させ、これにビーズ状のモレキュラーシーブ4Aを80g加えたのち、30分間窒素気液下に機伸する。この溶液に塩化亜鉛10g(73.4ミリモル)を加え、加熱湿液しながら7時間機件する。反応終7後、実施例1と同様に後処理して4S-2メチルー4ーソプロビルオキサゾリン8.75g(69.1ミリモル)を得た。 収率 71.3%

モレキュラーシーブを用いないこと以外は実施例1と同様に反応、後処理(但し、モレキュラーシーブの除去作

用は行わない) して、4R-2-メチル-4-フェニルオキサゾリン0.551g (3. 42ミリモル) を得た。収率4.7%

【0019】比較例2

アセトニトリルとして含水率。重量%のアセトニトリル を使用し、モレキュラーシーブを用いないこと以外は実 施倒1と同様に反応、後処理 (但し、モレキュラーシーブの除去作用は行わない) して、4 R ー 2 ー メテルー 4 ーフェニルオキサゾリン 1. 11 g (6.92 ミリモル) を得た。板単9.5%